材料研究学报 2007, 21(3) 0-266 DOI: ISSN: 1005-3093 CN: 21-1328/TG

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

硅烷偶联剂在二氧化硅基片表面吸附膜的形貌

蔡楚江 沈志刚 邢玉山 麻树林

摘要:

使用原子力显微镜(AFM)观测了吸附在二氧化硅基片表面的硅烷偶联剂薄膜的形貌.结果表明,在气相法吸附过程中偶联剂是以分子形态吸附在基片表面,而在液相法吸附过程中偶联剂是以分子聚合体的形态吸附在基片表面,因此通过气相法吸附在基片表面的吸附膜比通过液相法吸附在基片表面的吸附膜光滑.硅烷偶联剂在二氧化硅基片表面有化学吸附和物理吸附两种模式,吸附了硅烷偶联剂薄膜的基片表面呈现出一定的疏水性.

关键词:

Abstract:

Keywords:

收稿日期 1900-01-01 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期 2007-06-25

DOI:

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

Copyright 2008 by 材料研究学报

扩展功能

本文信息

Supporting info PDF<u>(2904KB)</u> [HTML全文]<u>(1KB)</u> 参考文献[PDF] 参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友 加入我的书架 加入引用管理器

引用本文

Email Alert 文章反馈 浏览反馈信息

> 本文关键词相关文章 本文作者相关文章

- ▶ 蔡楚江
- ▶ 沈志刚
- ▶邢玉山
- ▶麻树林